

01;04;09

# ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА ПОПЕРЕЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПУЧКОМ НА КРИТИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАДИАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ШАРА

© Н.С.Бухман

Мичуринская государственная сельскохозяйственная академия,  
Мичуринск, Россия  
(Поступило в Редакцию 24 декабря 1994 г.)

Предложен метод расчета резонансного поля, возбуждаемого электромагнитным пучком на критической поверхности радиально-неоднородного плазменного шара. Предложенный метод позволяет свести задачу расчета распределения резонансного поля по критической поверхности к вычислению двухкратного (в случае неосесимметричного пучка) интеграла хорошо изученного типа (интеграл типа Кирхгофа). Обсуждается вопрос о предельной неоднородности поперечного распределения резонансного поля и о возможных путях увеличения поперечной однородности резонансного прогрева плазменной сферы.

## Введение

Известно [1,2], что при отражении электромагнитной волны от плавнонеоднородного слоя слабостолкновительной плазмы с максимальной плотностью, превышающей критическую для данной частоты волны  $\omega$  ( $n_{cr} = m\omega^2/4\pi e^2$ ) на критической поверхности плазменного слоя, определяемой условием  $n = n_{cr}$ , происходит резонансное возрастание продольной (в направлении градиента диэлектрической проницаемости) компоненты электрического поля падающей волны — плазменный резонанс. Продольное распределение резонансного поля не зависит от структуры падающей волны и определяется тем или иным [1,2] механизмом ограничения резонанса. Поперечное же распределение резонансного поля зависит как от характеристик пространственного распределения плазмы, так и от структуры падающей волны. Поперечное распределение резонансного поля, возбуждаемое электромагнитным пучком на плоской критической поверхности, рассчитано в [3]. Между тем основной практический интерес (в частности, в исследованиях, связанных с проблемой лазерного термоядерного синтеза) предста-

влияет распределение резонансного поля на сферической критической поверхности.

В данной работе предлагается метод расчета поперечного (по критической поверхности) распределения резонансного поля, возбуждаемого на сферической критической поверхности радиально-неоднородного плазменного шара парааксиальным электромагнитным пучком. Предлагаемый подход основан на использовании интеграла Кирхгофа [4,5] и позволяет выразить резонансное поле в квадратурах от первичного (вакуумного) поля падающего на плазменный шар пучка на плоскости  $z = 0$ , проходящей через центр плазменного шара 0 перпендикулярно направлению распространения пучка ( $0z$ ).

Поскольку для рассматриваемой задачи характерна сферическая симметрия (плазменного шара), то естественным представляется следующий путь ее решения: а) следует разложить падающую волну по сферическим гармоникам (ввиду векторного характера задачи речь идет о разложении по векторным сферическим функциям [6-8]); б) далее необходимо найти резонансное поле, возбуждаемое на сферической критической поверхности отдельной векторной сферической гармоникой; в) просуммировав полученные в пункте б парциальные резонансные поля с весами, полученными в пункте а, следует отыскать суммарное резонансное поле, возбуждаемое падающей волной.

Отметим, что задача а относится к теории дифракции электромагнитных волн в вакууме: коэффициенты разложения падающей на плазменный шар волны по сферическим гармоникам не зависят, разумеется, от объекта, на который падает волна, и определяются только первичным (вакуумным) полем пучка. При решении задачи б, напротив, можно отвлечься от специфики пучка и ограничиться изучением резонансного поля, возбуждаемого на критической поверхности шара падающей волной весьма специального вида (сферической гармоникой). Объединение "дифракционной" и "плазменной" компонент изучаемой проблемы происходит при решении задачи в. Впрочем, как станет ясно из дальнейшего, и задачу в удастся свести к хорошо изученной стандартной задаче скалярной теории дифракции волн в вакууме, что позволяет говорить о решении поставленной в данной работе задачи в квадратурах. Приступим к реализации намеченной программы.

## Сферический спектр скалярной волны

Решим сначала более простую задачу вакуумной скалярной теории дифракции о связи апертурного вакуумного поля волны (на плоскости  $z = 0$ ) с ее скалярным сферическим спектром (т.е. с коэффициентами ее разложения в ряд по скалярным сферическим функциям [9,10]). Пусть амплитуда  $u(\mathbf{r})$  скалярной волны  $u(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)$  удовлетворяет вакуумному скалярному волновому уравнению  $\Delta u + k_0^2 u = 0$  ( $k_0 = 2\pi/\lambda_0$  — вакуумное волновое число). Пусть, кроме того,  $u(\mathbf{r})$  — парааксиальный волновой пучок, распространяющийся вдоль оси  $0z$  (для определенности, от положительных к отрицательным значениям  $z$ ). Пусть  $u_0(\rho)$  — вакуумная амплитуда поля на плоскости  $z = 0$ , проходящей через начало системы координат 0 перпендикулярно направлению распространения

пучка  $0z$ . Тогда, используя метод Кирхгофа [4,5], нетрудно получить для амплитуды поля  $u(\mathbf{r})$  вдали от плоскости  $z = 0$

$$u_{\pm}(\mathbf{r}) = \mp(ik_0^2/4\pi) \iint (1 \pm z/R)u_0(\boldsymbol{\rho}) \exp(\pm ik_0R)/RdS, \quad (1)$$

где  $u_{\pm}(\mathbf{r})$  — амплитуда поля при  $z > 0$  (при знаке “плюс”) или при  $z < 0$  (при знаке “минус”),  $R = \mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}$ .

Интегрирование в (1) осуществляется по переменной  $\boldsymbol{\rho}$  ( $\boldsymbol{\rho} = (\rho, \psi)$ ) на плоскости  $z = 0$ . Амплитуда поля  $u(\mathbf{r})$  удовлетворяет условию излучения Зоммерфельда  $\lim_{r \rightarrow \infty} (\partial u_+/\partial r - ik_0 u_+) = 0$  [4,5] и состоит из уходящих от центра 0 сферических волн, а амплитуда поля  $u_-(\mathbf{r})$  удовлетворяет противоположному условию  $\lim_{r \rightarrow \infty} (\partial u_-/\partial r - ik_0 u_-) = 0$  и состоит из приходящих из бесконечности (т.е. падающих на центр) сферических волн. Поэтому поле  $u_+$  можно отождествить с падающей на центр 0 волной, а поле  $u_-$  — с отраженной от центра (уходящей) волной.

Обычно формулы типа (1) используются для расчета “уходящей” волны  $u$ . Но в данном случае нас интересует сферический спектр падающей на центр волны  $u_+$ , т.е. коэффициенты  $A_{jm}$  заведомо справедливого при  $k_0 r \rightarrow \infty$  разложения [4]

$$u_+ = [\exp(ik_0 r)/(k_0 r)] \sum_{jm} A_{jm} Y_{jm}(\theta, \phi), \quad (2)$$

где  $Y_{jm}$  — скалярные сферические функции [9-11], в набор коэффициентов  $\{A_{jm}\}$  естественно именовать сферическим спектром падающей волны.

Используя под интегралом (1) мультипольное разложение сферической волны  $\exp(+ik_0 R)/R$ , асимптотические свойства функций Бесселя и Ханкеля [9], а также парааксиальность волны  $u_+$ , нетрудно получить для сферического спектра падающей волны выражение

$$A_{jm} = (-i)^{m+1} u_{0m}(\rho_j) (k_0 \rho_j)^{1/2}, \quad (3)$$

где введено обозначение  $\rho_j = j/k_0$ , а

$$u_{0m}(\rho) = \int_0^{2\pi} u_0(\boldsymbol{\rho}) [\exp(-im\psi)/\sqrt{2\pi}] d\psi$$

— коэффициенты фурье-разложения функции  $u_0(\rho, \psi)$  в ряд по азимутальному углу  $\psi$ .

Для уяснения физического смысла соотношения (3) достаточно вспомнить [6,7], что  $\rho_j$  — это прицельный параметра фотона с импульсом  $(h/2\pi)k_0$  и моментом импульса  $(h/2\pi)[f(j+1)]^{1/2} \approx (h/2\pi)f$ . Вполне естественно, что амплитуда вакуумного поля пучка на расстоянии  $\rho_j$  от центра 0 контролируется количеством фотонов с квантовым числом углового момента  $j$ .

Обратимся теперь к случаю электромагнитной волны. Для обобщения "скалярной" теории на векторный случай достаточно вспомнить, что потенциалы Лебая [4] электромагнитной волны удовлетворяют скалярному волновому уравнению, воспользоваться только что полученными "скалярными" результатами для потенциалов Лебая, а затем перейти от потенциалов Лебая к напряженностям электрического и магнитного поля.

В итоге нетрудно получить следующее разложение для дальнего поля ( $r \rightarrow \infty$ ) падающего на центр 0 параксиального электромагнитного пучка:

$$\mathbf{E}_+^e = [\exp(ik_0 r)/(k_0 r)] \sum_{jm} A_{jm}^{(e)} \mathbf{Y}_{jm}^{(+1)}(\theta, \phi), \quad (4)$$

где  $\mathbf{Y}_{jm}^{+1}(\theta, \phi)$  — поперечная векторная сферическая функция электрического типа [6,7],

$$A_{jm}^{(e)} = (-i)^m E_{0m}^{(e)}(\rho_j)(k_0 \rho_j)^{1/2}, \quad (5)$$

где по-прежнему  $\rho_j = j/k_0$ ,

$$E_{0m}^{(e)}(\rho) = \int_0^{2\pi} E_0^{(r)}(\rho) [\exp(-im\psi)/\sqrt{2\pi}] d\psi, \quad E_0^{(r)}(\rho) = \mathbf{E}_0(\rho)\rho/\rho.$$

Прокомментируем соотношения (4), (5). Формула (4) дает разложение не всего падающего на центр поля, а только его  $e$ -компоненты (о чем и напоминает верхний индекс). Полное падающее поле содержит  $e$ - и  $n$ -компоненты [6,7], но  $h$ -компонента не возбуждает резонансное поле (см. ниже) и поэтому здесь не рассматривается. Смысл соотношения (5) аналогичен смыслу соотношения (3) с одним лишь отличием: коль скоро речь идет о фотонах  $e$ -типа, то в расчет берется только радиальная компонента  $E_0^{(r)}(\rho)$  вакуумного электрического поля пучка на плоскости  $z = 0$ .

В заключение раздела подчеркнем еще раз, что сферический спектр падающей волны не зависит от характеристик плазменного шара, но зависит от характеристик пучка и местоположения центра плазменного шара 0, относительно которого проводится разложение (4) поля пучка в ряд по сферическим гармоникам. Поэтому сферический спектр пучка определяется именно его вакуумным полем  $\mathbf{E}_0(\rho)$  на плоскости, проходящей через точку 0 перпендикулярно направлению распространения пучка (параксиальный пучок имеет достаточно хорошо определенное направление распространения даже в случае отсутствия какой-либо симметрии; вакуумная ось пучка не обязана проходить через центр плазменного шара).

Полученные в данном пункте результаты позволяют связать сферический спектр параксиального электромагнитного пучка (который

удобен для расчета резонансного поля) с его вакуумным полем на апертуре  $z = 0$  (задание вакуумного поля пучка на апертуре является одним из наиболее простых и естественных способов задания первичного поля пучка).

## Резонансное поле отдельной сферической волны

Теперь займемся изучением резонансного поля, возбуждаемого на критической поверхности отдельной сферической гармоникой. Пусть  $n(r)$  — плотность плазмы, зависящая только от расстояния до центра плазменного шара 0 (являющегося началом нашей системы координат). Тогда комплексная диэлектрическая проницаемость плазмы  $\varepsilon(r)$  может быть записана в виде [1]

$$\varepsilon(r) = (1 - n(r)/n_{cr}) - i(n(r)/n_{cr})(\nu/\omega), \quad (6)$$

где  $n_{cr}$  — критическая плотность плазмы,  $\nu$  — эффективная (или эквивалентная [1,2]) частота столкновений ( $\nu \ll \omega$ ).

Пусть на достаточном удалении от центра шара плотность плазмы пренебрежимо мала. Тогда при  $r \rightarrow \infty$  поле произвольной электромагнитной волны может быть представлено в следующем виде [6,7]:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}^{(e)} + \mathbf{E}^{(h)}, \quad \mathbf{E}^{(e)} = \mathbf{E}_+^{(e)} + \mathbf{E}_-^{(e)}, \quad \mathbf{E}^{(h)} = \mathbf{E}_+^{(h)} + \mathbf{E}_-^{(h)}; \\ \mathbf{E}_\pm^{(e)} &= [\exp(\pm ik_0 r)/(k_0 r)] \sum_{jm} A_{jm\pm}^{(e)} \mathbf{Y}_{jm}^{(+1)}(\theta, \phi); \\ \mathbf{E}_\pm^{(h)} &= [\exp(\pm ik_0 r)/(k_0 r)] \sum_{jm} A_{jm\pm}^{(h)} \mathbf{Y}_{jm}^{(0)}(\theta, \phi); \end{aligned} \quad (7)$$

В (7) верхним индексом  $e$  отмечена  $e$ -компонента поля, верхним индексом  $h$  —  $h$ -компонента поля, нижний индекс “плюс” относится к падающей на центр волне, а нижний индекс “минус” — к отраженной (уходящей от центра) волне. Функции  $\mathbf{Y}_{jm}^{(+1)}(\theta, \phi)$ ,  $\mathbf{Y}_{jm}^{(-1)}(\theta, \phi)$  и  $\mathbf{Y}_{jm}^{(0)}(\theta, \phi)$  — описанные в [6,7] векторные сферические функции. Справедливость разложения (7) следует из полноты системы векторных сферических функций и из поперечности свободного электромагнитного поля. Для полноты картины можно добавить, что  $e$ -компонента поля описывается скалярным потенциалом Дебая  $U$ ,  $h$ -компонента поля — скалярным потенциалом Дебая  $V$  [4], а разложение полей  $E^{(e)}$  и  $E^{(h)}$  по векторным сферическим функциям эквивалентно разложению потенциалов Дебая  $U$  и  $V$  по скалярным сферическим функциям.

Разложение (7) справедливо только в вакууме и на достаточном удалении от центра 0, т.е. там, где возможно разделение волны на падающую и отраженную от центра компоненты. Нетрудно проверить, что при конечных  $r$  использование уравнений Максвелла с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon(r)$ , зависящей только от расстояния до центра 0, приводит к замене разложения (7) на

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^{(e)} + \mathbf{E}^{(h)}, \quad \mathbf{E}^{(e)} = \sum_{jm} \mathbf{E}_{jm}^{(e)}, \quad \mathbf{E}^{(h)} = \sum_{jm} \mathbf{E}_{jm}^{(h)}, \quad (8)$$

$$\mathbf{E}_{jm}^{(h)} = \frac{e_j^{(h)}(r)}{k_0 r} \mathbf{Y}_{jm}^{(0)}(\theta, \phi),$$

$$\mathbf{E}_{jm}^{(e)} = \frac{1}{k_0 r \varepsilon(r)} \left( \frac{1}{k_0} \frac{dh_j^{(e)}(r)}{dr} \mathbf{Y}_{jm}^{(+1)}(\theta, \phi) + \frac{h_j^{(e)}(r)}{k_0 r} [f(f+1)]^{1/2} \mathbf{Y}_{jm}^{(-1)}(\theta, \phi) \right),$$

$$\mathbf{H}_{jm}^{(e)} = \frac{h_j^{(e)}(r)}{k_0 r} \mathbf{Y}_{jm}^{(0)}(\theta, \phi). \quad (9)$$

В (9) радиальная функция  $e_j^{(h)}(r)$  определяется дифференциальным уравнением

$$\frac{d^2 e_j^{(h)}}{dr^2} + \left( k_0^2 \varepsilon(r) - \frac{f(f+1)}{r^2} \right) e_j^{(h)} = 0, \quad (10)$$

а радиальная функция  $h_j^{(e)}(r)$  — дифференциальным уравнением

$$\frac{d^2 h_j^{(e)}}{dr^2} - \frac{1}{\varepsilon} \frac{d\varepsilon}{dr} \frac{dh_j^{(e)}}{dr} + \left( k_0^2 \varepsilon(r) - \frac{f(f+1)}{r^2} \right) h_j^{(e)} = 0, \quad (11)$$

Последнее из уравнений (9) выписано для пояснения смысла функции  $h_j^{(e)}(r)$ .

В общем случае падающая волна  $\mathbf{E}_+$  определяется набором коэффициентов  $A_{jm+}^{(e,h)}$  в разложении (7). Эти коэффициенты определяют асимптотику функций  $e_j^{(h)}(r)$  и  $h_j^{(e)}(r)$  при  $r \rightarrow \infty$  (конечно, неполностью задается асимптотика той компоненты одномерных волн  $e_j^{(h)}(r)$  и  $h_j^{(e)}(r)$ , которая соответствует падающей волне). Совместно с требованием ограниченности функций  $e_j^{(h)}(r)$  и  $h_j^{(e)}(r)$  при  $r \rightarrow 0$  это позволяет однозначно найти функции  $e_j^{(h)}(r)$  и  $h_j^{(e)}(r)$  из (10) и (11) и затем определить полное поле (с использованием (8) и (9)).

В данной работе нас интересует только резонансное поле, возбуждаемое электромагнитным пучком на критической поверхности плазменного шара  $t = r_0$ , где плотность плазмы равна критической  $n(r_0) = n_{cr}$  и вещественная часть диэлектрической проницаемости плазмы обращается в 0. Видно, что функция  $e_j^{(h)}(r)$  не имеет особенностей и конечна при  $\varepsilon(r) = 0$ . Таким образом,  $h$ -компонента падающего поля не возбуждает плазменного резонанса на критической поверхности и поэтому в данном случае не представляет интереса, что и было отмечено выше (см. обсуждение формул (4) и (5)).

Что же касается  $e$ -компоненты поля, то анализ соотношений (9) и уравнения (11) показывает, что при  $\varepsilon(r) = 0$  поперечная компонента

поля (с угловой зависимостью  $Y_{jm}^{(+1)}$ ) имеет логарифмическую особенность, а продольная (с угловой зависимостью  $Y_{jm}^{(+1)}$ ) — гиперболическую особенность. Это свидетельствует о том, что  $e$ -компонента падающего поля возбуждает плазменный резонанс на критической поверхности. Разумеется, в случае  $\nu > 0$  диэлектрическая проницаемость плазмы не обращается в 0 при вещественных  $r$ , но вблизи критической поверхности она становится весьма мала, а электрическое поле весьма велико. Анализируя соотношение (9) для электрического вектора  $e$ -компоненты поля, нетрудно проверить, что при  $r \rightarrow \infty$  первый член в скобках доминирует над вторым и поле отдельной сферической гармоники  $E_{jm}^{(e)}$  поперечно и имеет угловую зависимость  $Y_{jm}^{+1}$  в соответствии с (7). Вблизи же критической поверхности при достаточно малых ( $\nu/\omega$ ) второй член в скобках доминирует над первым и резонансное поле, возбуждаемое отдельной сферической гармоникой вблизи критической поверхности, продольно и имеет угловую зависимость  $Y_{jm}^{(-1)}$ .

Из сделанных замечаний следует вывод о том, что для продольного резонансного поля<sup>1</sup> вблизи критической поверхности справедливо разложение

$$\mathbf{E}_{res} = R(r) \sum_{jm} A_{jm}^{(res)} Y_{jm}^{(-1)}(\theta, \phi), \quad (12)$$

где

$$R(r) = 1/[(r - r_0)/L - i(\nu/\omega)] \quad (13)$$

— обычный [1] резонансный фактор, а  $A_{jm}^{(res)} = f_j A_{jm\pm}^{(e)}$ , где  $\{f_j\}$  — набор некоторых коэффициентов, зависящих от  $f$ , но не зависящих от  $r$  и определяемых связью между “дальней” (при  $r \rightarrow \infty$ ) и “ближней” (при  $r \rightarrow r_0$ ) асимптотиками решения дифференциального уравнения (11).

К сожалению, решения уравнения (11) не содержатся в классе обычно используемых специальных функций даже при простейших предположениях о характере радиальной зависимости плотности плазмы  $n(r)$  от радиальной координаты  $r$ .

Тем не менее это уравнение удастся решить асимптотически методом эталонных дифференциальных уравнений (9), (11) при следующих условиях:

$$k_0 \gg 1, \quad (k_0 r_0)(k_0 L)^{-1/3} \gg 1, \quad (\nu/\omega)(k_0 L) \ll 1. \quad (14)$$

В (14)  $r_0$  — радиус критической поверхности,  $\nu$  — эффективная частота столкновений,  $L$  — характерная длина радиальной неоднородности плазмы вблизи критической поверхности (параметры  $r_0$  и  $L$  определяются соотношениями  $n(r_0) = n_{cr}$  и  $n'(r_0) = -n_{cr}/L$ ).

Обсудим смысл условий (14). Первое из них может быть интерпретировано как условие плавнеоднородности плазмы. Второе условие

<sup>1</sup> Резонансную особенность вблизи критической поверхности имеет и поперечное поле. В данной работе мы ограничимся изучением продольного резонансного поля, которое велико по сравнению с поперечным (гиперболическая особенность сильнее логарифмической).

не имеет столь прозрачного смысла и возникает при математическом исследовании уравнения (11). Оно обычно выполнено в случае выполнения первого условия (например, для его выполнения достаточно добавить к первому условию требование " $L < r_0$  или  $L$  одного порядка с  $r_0$ "). Третье условие можно интерпретировать как условие слабости нерезонансного (обратно-тормозного) поглощения волны при распространении от периферии плазменного шара до критической поверхности (на расстояние порядка  $L$ ). Это условие нарушается достаточно часто, но из физических соображений ясно, что от него можно отказаться при дополнительном учете ослабления волны при распространении до критической поверхности, которое сводится к умножению амплитуды резонансного поля на фактор

$$\exp \left[ - (k_0/2) \int_{r_0}^{\infty} (n/n_{cr})(\nu/\omega)(1 - n/n_{cr})^{-1/2} dr \right].$$

Ясно, что нарушение этого условия (значительность обратно-тормозного поглощения волны при распространении в плазменной короне) приводит лишь к общему ослаблению резонансного поля без изменения его поперечного распределения по критической поверхности. В конечном счете это обстоятельство связано с большей селективностью резонансного поглощения по сравнению с обратно-тормозным по прицельному параметру падающего на плазменный шар фотона, т.е. с соотношением  $r_{am} \ll r_0$  (см. формулу (16)).

При выполнении условий (14) в качестве эталонного для дифференциального уравнения (11) может быть использовано дифференциальное уравнение плазменного резонанса [1], которое получается из (11) при  $\nu = 0$ , линейной зависимости плотности плазмы от радиальной координаты  $r$  (т.е. при  $n(r) = n_{cr}(1 - (r - r_0)/L)$ ) и при замене члена  $f(f+1)/r^2$  его значением при  $r = r_0$ . Дифференциальное уравнение плазменного резонанса хорошо изучено и его решения табулированы [1,2,12,13]. В результате проведенного рассмотрения получена следующая формула для коэффициентов  $f_j$ :

$$f_j = \frac{\Phi_D(\rho_j/r_{am})}{\sqrt{2\pi}(k_0 r_0)(k_0 L)^{1/2}} \exp \left[ i \left( \phi_0 - \frac{3}{4}\pi + \frac{k_0 \rho_j^2}{2r_{ph}} \right) \right], \quad (15)$$

где  $\Phi_D(\rho_j/r_{am})$  — функция Ленисова, связанная с табулированной в [12,13] функцией резонансного поглощения при отражении  $Q(\tau)$  соотношением  $Q(\tau) = \Phi_D^2(\tau)/2$ , а фаза  $\phi_0$  и параметры  $r_{am}$  и  $r_{ph}$  определяются соотношениями

$$\begin{aligned} \phi_0 &= k_0 r_0 - \int_{r_0}^{\infty} (k(r) - k_0) dr, \quad r_{am} = r_0 (k_0 L)^{-1/3}, \\ 1/r_{ph} &= k_0 \int_{r_0}^{\infty} dr / (r^2 k(r)), \end{aligned} \quad (16)$$

где  $k(r) = k_0(\varepsilon_r(r))^{1/2} = k_0[1 - n(r)/n_{cr}]^{1/2}$ .



В заключение раздела отметим, что набор коэффициентов  $\{f_j\}$  зависит только от свойств плазменного шара и не зависит от характеристик падающего на шар пучка, причем этот набор коэффициентов полностью определяет свойства плазменного шара с точки зрения возбуждения резонансного поля на его критической поверхности. Сам же этот набор коэффициентов полностью определяется величиной параметров  $r_0$ ,  $L$ ,  $r_{am}$ ,  $r_{ph}$  и  $\phi_0$ . При этом третий из пяти приведенных параметров является простой комбинацией первых двух, а пятый обычно несуществен (потому что он определяет общую фазу резонансного поля на критической поверхности и не влияет на величину и распределение резонансного поля). От характера радиальной зависимости плотности плазмы  $n(r)$  зависит только четвертый из приведенных параметров. Впрочем, нетрудно показать, что в случае  $L \ll r_0$  из (16) следует  $r_{ph} = r_0$  (в наиболее часто встречающемся случае  $L \approx r_0$  для оценок можно положить  $r_{ph} \approx r_0$ ). Сказанное означает, что по существу резонансное поле, возбуждаемое пучком на критической поверхности плазменного шара, не зависит от распределения плотности плазмы вдали от критической поверхности и определяется только величиной параметров  $r_0$  и  $L$ , характеризующих функцию  $n(r)$  вблизи критической поверхности.

### Интегральное представление для резонансного поля

Полученные выше результаты позволяют представить резонансное поле, возбуждаемое пучком на критической поверхности, в виде ряда по сферическим функциям (см. формулы (5), (12) и (15))

$$\mathbf{E}_{res} = R(r) \sum_{jm} (-i)^m f_j E_{0m}^{(e)}(\rho_j) (k_0 \rho_j)^{1/2} \mathbf{Y}_{jm}^{(-1)}(\theta, \phi), \quad (17)$$

где продольная векторная сферическая функция  $\mathbf{Y}_{jm}^{(-1)}(\theta, \phi)$  может быть выражена через скалярную сферическую функцию  $Y_{jm}(\theta, \phi)$  с помощью известного соотношения  $\mathbf{Y}_{jm}^{(-1)}(\theta, \phi) = (\mathbf{r}/r) Y_{jm}(\theta, \phi)$ .

Удобно перейти от ряда (17) к интегральному представлению типа интеграла Кирхгофа, используя "в обратном направлении" формулу (3) для сферического спектра скалярной волны. Действительно, введя в рассмотрение фиктивную скалярную<sup>2</sup> волну  $u^{(sp)}$ , вакуумное поле которой на плоскости  $z = 0$  определяется соотношением

$$u_0^{(sp)}(\rho) = i f(\rho) E_0^{(r)}(\rho), \quad (18)$$

где функция  $f(\rho)$  определяется соотношением  $f(\rho_j) = f_j$ , и сопоставив формулы (2), (3) с формулами (17), (18), нетрудно убедиться, что

$$\mathbf{E}_{res} = (\mathbf{r}/r) R(r) \Phi_{res}(\theta, \phi), \quad (19)$$

где угловая диаграмма распределения резонансного поля по критической поверхности  $\Phi_{res}(\theta, \phi)$  одновременно является и диаграммой

<sup>2</sup> Т. е. подчиняющуюся скалярному волновому уравнению.

направленности на бесконечности падающей (на центр 0) компоненты пучка  $u^{(sp)}$

$$u_+^{(sp)} = [\exp(ik_0 r)/(k_0 r)] \Phi_{res}(\theta, \phi). \quad (20)$$

Но для отыскания диаграммы направленности пучка  $u^{(sp)}$  на бесконечности тоже может быть использован метод Кирхгофа

$$u_+^{(sp)}(\mathbf{r}) = -(ik_0^2/2\pi) \iint u_0^{(sp)}(\rho) \exp(ik_0 R)/R dS, \quad (21)$$

откуда для угловой диаграммы распределения резонансного поля по критической поверхности (см. (19)) имеем окончательный результат

$$\begin{aligned} \Phi_{res}(\theta, \phi) = & -A(ik_0^2/2\pi) \iint K_{am}(\rho) K_{ph}(\rho) E_0^{(r)}(\rho) \times \\ & \times \exp(-ik_0 \rho \theta \cos(\psi - \phi)) dS. \end{aligned} \quad (22)$$

В формуле (22) интегрирование ведется по плоскости  $z = 0$  ( $\rho$  и  $\psi$  — полярные координаты точки на этой плоскости,  $\rho = (\rho, \psi)$ ,  $dS = \rho d\rho d\psi$ ,  $\theta$  и  $\phi$  — полярные координаты точки на критической поверхности, в которой рассчитывается резонансное поле),  $E_0^{(r)}(\rho)$  — радиальная компонента вакуумного поля электромагнитного пучка на плоскости  $z = 0$  (определенная в формуле (5)), а константа  $A$  и функции  $K_{am}(\rho)$  и  $K_{ph}(\rho)$  получены при разложении на сомножители функции  $f(\rho)$  ( $if(\rho) = AK_{am}(\rho)K_{ph}(\rho)$ ) и определяются соотношениями

$$A = \frac{\exp\left[i\left(\phi_0 - \frac{1}{4}\pi\right)\right]}{\sqrt{2\pi}(k_0 r_0)(k_0 L)^{1/2}}, \quad K_{am}(\rho) = \Phi_D(\rho_j/r_{am}), \quad K_{ph}(\rho) = \exp\left[i\frac{k_0 \rho_j^2}{2r_{ph}}\right]. \quad (23)$$

Функция  $K_{ph}(\rho)$  имеет единичную амплитуду, а ее фаза квадратична по  $\rho$ , поэтому ее естественно интерпретировать как квадратичный фазовый корректор, т.е. тонкую линзу с фокусным расстоянием  $r_{ph}$ . Ясно, что параметр  $r_{ph}$  описывает влияние дефокусировки электромагнитного пучка в плазменной короне на распределение резонансного поля (а в случае, когда вакуумная ось пучка не проходит через центр плазменного шара, и его рефракцию в короне); в случае, когда дефокусировка пучка и рефракция лучей в короне не существенна, имеем  $r_{ph} = r_0 = \text{const}$ .

Функция  $K_{am}(\rho)$  вещественна, ее величина близка к 1 при  $\rho \approx r_{am}$  и мала при  $\rho \ll r_{am}$  и  $\rho \gg r_{am}$  (это следует из известных свойств функции Денисова [1,2]). Поэтому ее естественно интерпретировать как амплитудный корректор (т.е. как диафрагму с плавно изменяющейся по поверхности прозрачностью). Ясно, что амплитудный корректор  $K_{am}(\rho)$  описывает влияние прицельного параметра луча на эффективность возбуждения резонансного поля этим лучем (что же касается влияния рефракции лучей в короне на возбуждение резонансного поля, то, как показано в [14], этого влияния нет).

Полученные в итоге проведенного рассмотрения формулы (19), (22) позволят свести расчет резонансного поля, возбуждаемого электромагнитным пучком на сферической критической поверхности, к вычислению двухкратного (в худшем случае) интеграла типа скалярного интеграла Кирхгофа (22). Техника вычисления подобных интегралов хорошо разработана [4,5], поэтому с вычислительной точки зрения задача расчета резонансного поля становится тривиальной.

В случае осесимметричного эллиптичскиполяризованного пучка, вакуумная ось которого проходит через центр плазменного шара, интегрирование по переменной  $\psi$  в (22) осуществляется в общем виде, что позволяет определить зависимость резонансного поля от азимутального угла  $\phi$ . Нетрудно, например, убедиться, что в случае линейной поляризации пучка в направлении угла  $\phi_0$  имеем  $|\Phi_{res}(\theta, \phi)|^2 = |\Phi(\theta)|^2 \cos^2(\phi - \phi_0)$ , причем  $\Phi(\theta) = 0$  при  $\theta = 0$ , т.е. распределение резонансного поля на критической поверхности имеет "гантелеобразную" форму (ось "гантели" направлена в направлении поляризации падающей волны). В случае циркулярной поляризации падающего на плазменный шар пучка  $|\Phi_{res}(\theta, \phi)|^2 = |\Phi(\theta)|^2$ , причем  $\Phi(\theta) = 0$  при  $\theta = 0$ , т.е. распределение интенсивности резонансного поля становится осесимметричным и напоминает кольцо.

Но для понимания качественных особенностей распределения резонансного поля наиболее полезным оказывается промежуточный результат (18)–(20) о совпадении угловой диаграммы распределения резонансного поля на критической поверхности (19) с диаграммой направленности фиктивного скалярного пучка (20), задаваемого своим полем на апертуре  $z = 0$  (18). Это связано с тем, что качественно связь апертурного поля пучка и его диаграммы направленности хорошо изучена [4,5] и достаточно прозрачна.

Из (18)–(20) нетрудно вывести, например, формулу для интегрального коэффициента резонансного поглощения пучка. Для этого достаточно учесть, что мощность резонансного поглощения определяется интегралом по углам от  $|\Phi_{res}(\theta, \phi)|^2$  и тем же интегралом определяется мощность пучка  $u^{(sp)}$  (если находить ее через поле пучка на бесконечности). Но ту же мощность фиктивного пучка можно отыскивать и путем интегрирования интенсивности пучка  $u^{(sp)}$  по апертуре  $z = 0$ , что позволяет связать мощность резонансного поглощения с вакуумным апертурным полем нашего электромагнитного пучка. В итоге получаем для интегрального коэффициента резонансного поглощения формулу

$$Q_{(res)} = \frac{1}{2} \frac{\iint K_{am}^2(\rho) |E_0^{(r)}(\rho)|^2 dS}{\iint |E_0(\rho)|^2 dS}, \quad (24)$$

полученную другим способом и подробно обсужденную в [14]. Легко заметить, что коэффициент резонансного поглощения равен половине вакуумной мощности радиально-поляризованной компоненты пучка, проходящей (в вакууме) через плоское кольцо, лежащее в плоскости  $z = 0$ . Центр кольца совпадает с центром плазменного шара, а радиусы (внутренний и внешний) порядка  $r_{am}$ . Это означает, что для пуч-

ков, вакуумная ось которых проходит через центр шара, коэффициент резонансного поглощения максимален для пучков, вакуумный радиус которых вблизи центра плазменного шара примерно равен  $r_{am}$  (для эллиптически поляризованного пучка максимальное значение коэффициента поглощения равно 20–25% в зависимости от поперечного профиля пучка, для  $TH$ -пучка — в два раза больше). При этом  $r_{am} \ll r_0$  (при  $k_0L \gg 1$ ) и даже небольшое отклонение оси пучка от центра шара может привести к значительному изменению мощности резонансного поглощения.

Кроме того, приняв во внимание известные [1] свойства функции Лежандра, нетрудно заметить, что амплитудный корректор  $K_{am}(\rho)$  в (23) осуществляет “мягкое” (без резких границ) диафрагмирование фиктивного пучка в плоскости  $z = 0$ , причем радиус этой “диафрагмы” примерно равен  $r_{am}$ . Вспомнив известное соотношение между радиусом фокального пятна пучка и шириной его диаграммы направленности на бесконечности, нетрудно понять, что независимо от характеристик падающей волны угловой масштаб неоднородности резонансного поля на критической поверхности не может быть меньше  $1/k_0r_{am}$ , что соответствует линейному масштабу  $\lambda_0(k_0L)^{1/3} \gg \lambda_0$ .

Учитывая, что ни амплитудный, ни фазовый корректор в (23) не относятся к числу оптических элементов, приводящих к появлению мелко-масштабных неоднородностей поля, можно сделать вывод о том, что в процессе возбуждения резонансного поля не происходит дополнительного (по отношению к вакуумному полю) изрезания амплитудного профиля волны. В резонансном поле проявляются только те мелко-масштабные неоднородности, которые уже присутствовали в вакуумном поле волны (или появились при распространении в турбулентной плазменной короне), да и то в “урезанном” виде — неоднородности резонансного поля с линейным масштабом меньше  $\lambda_0(k_0L)^{1/3}$  подавляются.

Более того, мелко-масштабная неоднородность вакуумного поля электромагнитного пучка вблизи центра плазменного шара способна приводить к расширению угловой диаграммы распределения резонансного поля на критической поверхности (по той же самой причине, по которой уменьшение диаметра фокального пятна пучка приводит к расширению его диаграммы направленности). При характерном масштабе поперечной неоднородности вакуумного поля пучка вблизи центра плазменного шара порядка  $l$  ширина угловой диаграммы резонансного поля не может быть меньше  $1/k_0l$ . Из сказанного следует, что метод RRP [15] может рассматриваться как эффективный метод повышения однородности резонансного прогрева мишени в лазерном термоядерном синтезе без существенного снижения мощности резонансного поглощения.

Расширять угловую диаграмму распределения резонансного поля можно и путем острой фокусировки пучка в центр плазменного шара, но при этом значительно снижается коэффициент резонансного поглощения. Избежать этого снижения можно путем фокусировки пучка на плоскости  $z = 0$  в фокальное пятно с диаметром  $d$  меньше или порядка (желательно много меньше)  $r_{am}$ , причем центр фокального пятна должен находиться на расстоянии примерно  $r_{am} \ll r_0$  от центра шара. В этом случае угловой размер резонансного поля на критической

поверхности будет не меньше  $1/k_0 d$  (т.е. не меньше угла фокусировки падающего на плазменный шар электромагнитного пучка), а коэффициент резонансного поглощения будет примерно равен  $0.5 \cos^2 \gamma$ , где  $\gamma$  — угол между направлением поляризации линейно-поляризованного пучка и направлением сдвига его фокуса от центра плазменного шара. Этим методом можно либо сильно ослабить резонансное поглощение электромагнитного пучка (при  $\gamma = 90^\circ$ ), либо увеличить его примерно в два раза (при  $\gamma = 0^\circ$  по сравнению с максимально возможной мощностью резонансного поглощения для пучков, вакуумная ось проходит через центр шара).

Автор благодарен А.Д. Пилии и Е.Э. Гусакову за интерес к работе и конструктивную критику и А.А. Андрееву за ценные консультации.

### Список литературы

- [1] Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: Наука, 1967.
- [2] Голант В.Е., Пилия А.Д. // УФН. 1972. Т. 14. С. 413.
- [3] Бухман Н.С. // Физика плазмы. 1991. Т. 17. С. 185.
- [4] Ваганов Р.Б., Каценеленбаум Б.З. Основы теории дифракции. М.: Наука, 1982.
- [5] Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука, 1979.
- [6] Ахиезер А.И., Берестецкий В.В. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.
- [7] Давыдов А.С. Квантовая механика. М.: Наука, 1973.
- [8] Солимено С., Крозиньяни Б., Ди Порто П. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения. М.: Мир, 1989.
- [9] Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Специальные функции математической физики. М.: Наука, 1978.
- [10] Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. М.: Мир, 1979.
- [11] Федорюк М.В. Асимптотические методы для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1983.
- [12] Бухман Н.С. Изв. вузов. Радиофизика. 1990. Т. 33. С. 912.
- [13] Омельченко О.М., Панченко В.И., Степанов К.Н. Изв. вузов. Радиофизика. 1971. Т. 14. С. 1484.
- [14] Бухман Н.С. Об интегральном коэффициенте поглощения пучка электромагнитных волн на критической поверхности радиально-неоднородного плазменного шара. ЖТФ (в печати).
- [15] Тизончук В.Т. // УФН. 1991. Т. 16(1). С. 129.